

炭素 皮膜 可變 抵抗器의 摺動 雜音 減少에 關한 研究

(A Study on Decreasing of Sliding Noise of a Carbon Film Variable Resistor)

尹 在 剛*
(Jai Gang Yoon)

要 約

民生用 電子機器에서 가장 많이 사용되고 있는 部品中の 하나인 炭素 皮膜 可變 抵抗器에서 摺動子 移動時 발생하는 접촉 저항 변화의 원인을 분석하여 이에 대한 감소, 즉 摺動 잡음 감소를 위한 몇 가지 방법을 착안하여 실험 검토하고 그 결과를 정리하여 본 결과 均 한 크기를 가진 炭素 粉末 粒子로서 고루게 배합된 저항액을 사용하고 摺動子의 접촉점과 壓力を 증가하면 접촉 저항 및 접촉 저항 변화, 즉 摺動 雜音을 감소 시킬 수 있다.

Abstract

Contact resistance variation which may be called sliding noise in carbon film variable resistors whose resistance elements consists of linear resistivity distribution were measured with several kinds of sliders and were analyzed to reduce the contact resistance variation.

About the measuring method, the standard method of measuring contact resistance variation specified by the variable Resistance Components Institute was adopted.

By analyzing the experimental results, it has been shown that the primary cause of contact resistance variation is due to current constriction and small discharge sparks in the resistance film in the area close to the slide contact.

Moreover, it has been found that the sliding noise would be reduced by increasing the number of contact points, sliding speed, and pressure, and by using some kinds of insulation oil on the contacting surface.

High contact resistance variation is likely to occur in the area of high resistance variation in a logarithmic resistance taper.

I. 序 論

抵抗器의 구성 부문을 기능상으로 分類하면 支持基體, 抵抗器, 端子部, 保護外裝의 4部分으로 나눌 수 있으며 抵抗體의 特性에 관해서도 抵抗 温度 係數 또는 抵抗值 許容差에 관한 것들 여러 가지로 나눌 수

있으나 여기서는 炭素 皮膜 抵抗體에 대하여 그 雜音特性에 관해서 實驗研究한 것을 쓰기로 한다. 摺動 抵抗器에서는 熱雜音외에 電流雜音과 摺動雜音의 2 가지가 있는데 電流 雜音은 저항체에 전류가 흐를 때 발생하는 잡음이다. 지금 $\overline{\Delta V^2}$ 을 電流 雜音 自乘平均值 V 을 인가전압, R 을 저항치 Δf 을 잡음 등가 대역폭, f 을 주파수라하면

$$\overline{\Delta V^2} = K V^2 R \frac{\Delta f}{f} \quad (1)$$

*正會員, 崇田大學校 工科大學 電子工學科
(Dept. of Electronics Eng., Soong Jun Univ.)

接受日字 : 1982年 9月 27日

로 표시되며 대략 크기는 [μV^2] 정도이다.

摺動 雜音은 가변 저항의 회전축을 회전할 때 생기는 잡음으로 電流 雜音에 비하면 현저하게 큰 값을 가진다. 이 잡음도 一種의 $1/f$ 잡음으로 볼 수 있다. 炭素 可變 抵抗은 습기를 받으면 전해 현상에 의해 열화를 한다.^{[11], [12]}

II. 可變 抵抗器의 摺動 雜音 解析

雜音이란 必要한 信號에 干涉을 일으켜 信號를 不明確하게 하는 좋지 못한 優亂을 말하는 것으로 大體로 雜音의 瞬時 振幅은 정확히 알 수 없으며 雜音은 热雜音 低周波 雜音 亦雜音의 3 종으로 대별할 수 있다. 摺動 雜音은 可變 抵抗器의 回轉軸을 回轉할 때 생기는 雜音으로 電流 雜音에 比하면 顯著하게 큰 값을 가진다. 이 雜音도 一種의 $1/f$ 雜音으로 볼 수 있다. $1/f$ 雜音의 電壓 E_n 과 電流 I_n 은 다음과 같은 式(2), (3) 으로 表示할 수 있다.^{[9], [9]}

$$E_n^2 = \frac{KR^2}{f_a} \quad (2)$$

$$I_n^2 = -\frac{K}{f_a} \quad (3)$$

여기서 R 은 E_n 을 測定하는 2 點간의 抵抗이다. 接觸 雜音 등 $1/f$ 雜音의 スペクト럼 密度 $S(f)$ 는 다음과 같이 된다.

$$S(f) = \frac{A}{S} [V^2/\text{Hz}] \quad (4)$$

여기서 A 는 常数이다. $1/f$ 雜音의 電力은 周波数 f 가 감소하면 증가하므로 直流에서는 雜音이 無限大가 될 것 같으나 帶域幅을 고려하면 큰 모순은 생기지 않으나.^[8] 可變 抵抗器에 있어서 接觸抵抗(contact resistance, CR) 이라 함은 摺動子의 단자에서부터 抵抗 素子에 이르기까지의 電路에 存在하는抵抗을 말한다. 지금 摺動子가 어느 位置에 정지되어 있을 때 假例대로^{[4], [3]} 抵抗 양끝단자를 ①, ③이라 하고 ①, ③ 중간 接點端子를 ②라 하면 단자 ①과 ②사이의 저항과 단자 ②와 ③사이의 저항을 각각 측정하여 R_{12} 및 R_{23} 이라고 하면 이들 之은 항상 단자 ①과 ③ 사이의 전저항 R_{13} 보다 크게 나타난다. 즉 $R_{13} < R_{12} + R_{23}$ 가 成立되므로 接觸抵抗은 다음 式(5)와 같이 표시된다.^[6]

$$CR = \frac{(R_{12} + R_{23}) - R_{13}}{2} \quad (5)$$

그러나 式(5)는 摺動子가 抵抗素子의 어떤 位置에 停止된 경우 바로 그 點의 接觸抵抗만을 나타내므로 直線形 抵抗曲線을 갖는 抵抗素子上의 모든 點에서 큰 差가 없겠으나 對數形 抵抗曲線을 갖는 저항 소자에서는 摺動子의 位置에 따라 크게 차이가 나타난다.

결국 式(5)로 표시된 接觸抵抗은 可變 抵抗器의 摺動子 接觸面과 저항 소자 接觸面 사이에 존재하는 저항에서 기인되며 이것은 스위치 및 콘택터類 등에서 같이 金屬과 金屬이 相互 接觸하고 있는 狀態에서 나타나는 현상과 유사한 것이다. 즉 金屬이 상호 接觸하고 있는 경계면에서는 다른 부분에 비하여 높은 전기 저항이 나타나는데 이 저항을 바로 接觸抵抗이라 한다. 이러한 接觸抵抗을 原因의으로 구분하면 壓縮抵抗(constriction resistance)과 遷移抵抗(transition resistance)으로 구분할 수 있다. 먼저 壓縮抵抗은 어떤 2個의 導電部品이 接觸할 때에 境界部位를 크게 확대하여 보면 이 接觸은 平面 모든 點에서 接觸이 되어 있지 못하고 여러 개의 微細한 凹凸 接觸으로 되어 있다. 그러므로 導體內의 여러 電路가 接觸面 부근에서 斷面積이 좁아짐에 따라 導體内部에서 생기는 等電位面의 變動에 의하여 저항이 커진다. 이러한 壓縮抵抗을 理論의으로 구하는데 R. Holm에 의하면^{[5], [6]} 抵抗率이 각각 ρ_1 , ρ_2 인 두 導體가 相互 接觸하여 있고 그 接觸材質의 特性 限界範圍内에 있을 때에는 導體內의 電路는 幾何學的으로 周簡形으로 좁아지면서 接觸面으로 향하고 있다고 가정하여 抵抗을 表現하는 式은 다음과 같이 된다.^[5]

$$R_c = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2} \sqrt{\frac{\pi f}{n F}} \quad (6)$$

여기서 ρ_1 , ρ_2 는 接觸 導體의 抵抗率 [$\Omega \cdot \text{cm}$]

n 는 接觸點의 수

f 는 彈性限界 [kg/cm^2]

F 는 接觸壓力 [kg] 이다.

앞에서와 같이 2個의 導電部品이 接觸할 경우 이 接觸面에는 여러 가지의 有機分子, 吸着ガス, 酸化物 기타 汚物이 있기 때문에 金屬의 경우 數分内에 50[\AA] 정도의 두께를 갖는 皮膜이 생기게 되고 數百[\AA] 이 될 때 까지 계속 皮膜이 생긴다. 이렇게 形成된 皮膜은 複雜한 電氣的 特性을 가지는데 두께가 數十[\AA] 정도 이하일 때는 遷移抵抗은 작고 무시된다. 皮膜이 半導體일 경우 接觸抵抗 R_t 는 다음 式(7)과 같이 쓸 수 있다.

$$R_t = \rho_s \cdot \frac{df}{F} \quad (7)$$

여기서 ρ_s 는 皮膜의 抵抗率 [$\Omega - \text{cm}$]

d 는 皮膜의 두께 [cm]

f 는 弹性限界 [kg/cm^2]

F 는 接觸壓力 [kg] 이다.

만일 形成된 皮膜이 $100[\text{\AA}]$ 이상 두께일때는 거의 絶緣 狀態이고 별도로 조치를 해야 한다. 이러한 原因에 의하여 接觸抵抗은 遷移抵抗이 絶緣 狀態가 아닌 경우는 壓縮抵抗 R_c 와 遷移抵抗 R_T 의 합으로 다음 式 (8)과 같이 表現할 수 있다.

$$CR = R_c + R_T =$$

$$= \frac{\rho_1 + \rho_2}{2} \sqrt{\frac{\pi f}{nF}} + \rho_s \frac{df}{F} \quad (8)$$

결국 可變抵抗器의 CRV는 式 (8)로 表現된 CR의 여러 變數들이 變化됨에 따라 생길다고 볼 수 있다. 式 (8)에서 ρ 의 變化가 CRV에 미치는 영향을 檢討하여 볼 때 抵抗 素子를 형성하고 있는 炭素 皮膜의 分子的構造가 均一하게 塗膜되어 있지 못하여 皮膜에 흐르는 電流가 그때그때 最少抵抗이 되는 電路를 따라 흐르기 때문에 CRV가 생기는 것으로 해석할 수 있다. 따라서 接觸力 F 를 증가시키면 接觸點數가 또는 接觸面積이 증가하게 되어 接觸抵抗이 감소될 것이다. 그러나 接觸力 F 가 적을 경우에는 그 使用材料의 弹性限界 f 가 적은 柔軟한 材料들을 선택하여야 할 것이다. 또 摆動子의 反복操作으로 그 表面을 매끄럽게 하여 有効 接觸面積을 증가시킴으로 안정된 CRV를 얻을 수도 있다. 또 摆動子의 摆動接觸面을 構造의으로 증가하기 위해서 摆動子 接點數 n 을 증가시킴으로써 CRV를 減少시킬 수 있다.

III. 試料製作

抵抗 素子製作에 사용된 재료들은 다음과 같다.

1) 黑鉛: 日本黑鉛商社

平均粒徑: $1 \sim 25 [\mu]$

2) 카본브랙: 日本電化

平均粒徑: $420 [\text{\AA}]$

3) 石炭酸樹脂: 日本住友

4) 銀粉: 德力化學研究所

5) 摆動子:

두께: $0.2 [\text{mm}]$

引張 강도: $70 \sim 80 [\text{kg}/\text{mm}^2]$

다음 표 1과 같은 重量比로 抵抗液과 端子部液을 配合했다.

炭素 皮膜 可變 抵抗器의 摆動 雜音 減少에 關한 研究

표 1. 저항체 조성

Table 1. Composition of resistance paste.

비 례 적 분 리	Graphite				Carbon Black	Phenol Resin	Silver Powder	Thinner
	CSSP	CSP	ASP	A P	AB	PC-25	TCG-1	TP-63
低抵抗	1	2	-	1.5	-	2	-	4
中抵抗	-	3	0.2	-	2	4	-	5
高抵抗	3	-	-	-	2	5	-	6
端子部	-	-	-	-	-	1	1	1

이 混合液들은 각각 1분간에 7회 정도의 속도로 溶拌混合器로 6회에 걸쳐서 混合한 후 直徑 $50[\text{cm}]$, 길이 $[cm]$ 정도의 磁器混合圓筒에 넣어 磁器 구슬과 함께 밀봉하고 混合筒을 分당 4~5회 회전하면서 100시간 정도 混合한 다음 $0.5 \times 50 \times 500[\text{mm}]$ 로 절단된 페놀樹脂積層板에 한쪽에 전체에 高抵抗液을 塗膜印刷하고 약 2분간 $160[\text{^\circ C}]$ 에서 건조를 하고 抵抗 素子上에 적당한抵抗曲線을 얻기 위하여 단자측에 銀을 塗膜印刷한다. 銀단자 사이에 마스크 기울기가 0° 부터 5° 쯤 85° 까지 되도록 抵抗接合面을 여러 가지로 제작한다. 이들은 $250 \pm 10[\text{^\circ C}]$ 로 1시간 유지하여 에이징을 하고 自然 狀態에 5시간 정도 放置하면 試料製作이 完了된다.

다음 摆動子는 直徑이 $0.3[\text{mm}]$, 길이가 $30[\text{mm}]$ 되도록 절단하여 6本을 포개고 끝단에 洋白板을 덧붙여 鋼着固定한다. 抵抗 素子가 接觸壓力이 $50 \sim 100 [\text{gr}/\text{cm}]$ 되도록 구부림角度로 조정한다.

IV. 實驗

그림 1과 같은 試驗回路에 의해 定電流 I가 抵抗 素子의 ①, ② 간에 흐르므로 ②, ③ 간에 나타난 電壓, 즉 CR 및 CRV를 測定한다. 試驗 素子와 측정기 사이에는 $100[\text{Hz}] \sim 50[\text{KHz}]$ 의 대역 여파기를 연결한다. 실제 측정에서는 같은 조건의 실험도 수십 회의 측정을 평균한다. 摆動子의 驅動은 $1800[\text{r.p.m.}]$ 의 直流 小形 電動기의 속도를 可變시키고 프라스틱齒車와 水平齒車를 써서 水平齒動으로 變換하고 速

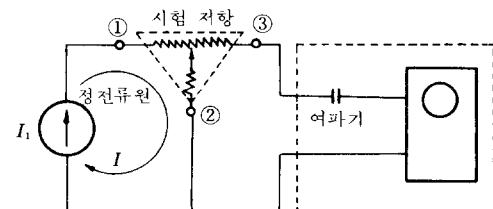


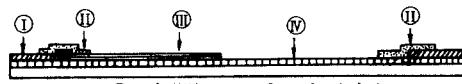
그림 1. 試驗회로

Fig. 1. Experimental circuit.

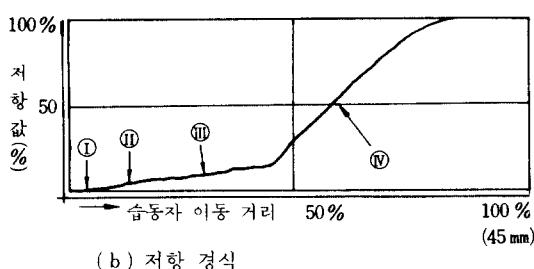
度가 45[mm]片道를 0.5~4[초]에 走行토록 한다. 摺動子의 壓力を 조정할 수 있게 摺動子 支持台인 絶緣體에 구멍을 만들고 이 구멍을 통하여 摺動子에 壓力이 전달될 수 있게 스프링 壓力計를 絶緣軸에 垂直方向으로 裝置한다. 壓力은 10[gr/cm]~120[gr/cm] 이다.

電源은 直流 0~30[V], 0.05, 0.1, 1, 10, 30 [mA]이고, 오시로스코프는 2 현상 스코우프로써 直流電壓 變動과 交流를 測定하는데 사용한다. 抵抗 素子의 各 抵抗段의 表面 粗度는 銀端子部는 약 4[mm] 低抵抗 部位는 5[μm] 中抵抗 部位는 약 5~10[μm] 이고, 高抵抗 部位(IV)는 1~2[μm]이다. CRV는 그림 2에서와 같이 高抵抗 部位(IV)에서 약 2[kΩ], 中抵抗 部位(III)는 0.4[kΩ]을 나타내고 있으나 銀端子 部位(I) 및 低抵抗 部位(II)의 CRV는 아주 낮은 0.2[kΩ]이하이다.

抵抗 素子 表面 粗度의 영향을 측정한 즉 CRV는 主로 高抵抗 部位에서 發生함을 알 수 있으며 高抵抗 部位의 CRV는 6.5~8[%]이며 境界 角度 變化에는



(a) 저항 소자 단면



(b) 저항 경식

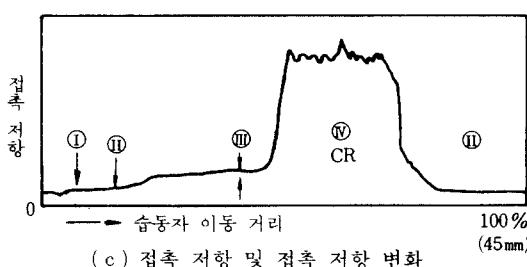


그림 2. 저항체 단면 및 특성 곡선

Fig. 2. Sectional figure of a resistor and characteristic curves.

별차이가 없다. 6本의 摺動子인 경우에는 接觸抵抗은 全抵抗值의 1~1.5[%], CRV는 全抵抗值의 0.15~0.25[%] 정도로 境界 角度의 영향은 거의 없다. 摺動回數가 약 12,000회 이상되면 안전 상태가 되어 CRV의 변화는 없어진다. 接觸抵抗은 摺動子의 接點數의 증가에 따라 7[%]에서 1[%]까지로 거의 指數函數의으로 감소하고 CRV도 유사한 감소를 한다. 接觸抵抗은 摺動壓力이 20[gr/cm]에서 120[gr/cm] 까지 증가하면 微小한 감소를 보였고 CRV는 10~30[gr/cm]에서 현저한 변화가 있었고 30[gr/cm] 이상에서는 미소한 감소가 나타났다. 接觸抵抗이 크면 CRV도 역시 크다.

V. 結論

炭素皮膜可變抵抗器의 摺動雜音 즉 접촉 저항 변화를 몇 가지 특성 곡선을 가지는 저항 소자에 대하여 壓力, 접촉자의 모양·수·속도 등을 바꾸면서 그 특성을 시험한 바 잡음 감소를 위하여 다음과 같이 요약할 수 있다.

- 1) 炭素粉末은 가능한한 균일한 크기의 갖도록 함이 좋다.
- 2) 접촉 저항 변화가 제일 큰 곳은 저항 변화 특성 곡선의 경사가 제일 큰 고저항 부분에서이고 각 저항단에서의 표면 조도의 영향은 거의 없다.
- 3) 摺動子의 摺動壓力과 摆動速度는可能な 범위에서는 클수록 접촉 저항 변화가 작아진다. 그러나 마모는 빠르고 수명은 짧을 것이다.
- 4) 摺動子의 摆動片수가 많을수록 접촉 저항 변화는 작아지나 摆動子의 접촉부의 모양에는 별영향을 받지 않는다.
- 5) 저항체 표면에 몇 가지의 絶緣油을 도포하여도 접촉 저항 변화에 좋은 영향은 없었으나 앞으로 더 연구할 필요가 있다고 본다.

끝으로 본연구를 지원해 준 산학재단에 감사를 드립니다.

参考文献

- [1] Stanley Schneider and David Silverman, *Resolution and Noise Their Significance and Measurement in Non-Wirewound Potentiometers*. National Electronic Conference, pp. 900-907, 1970.
- [2] Variable Resistance Components Institute, VRCI, *Wirewound and Non-Wirewound Precision Potentiometers*. June 1975.

- [3] Japanese Industrial Standards, *Variable Carbon Resistors for General Use*. C6443, pp. 425-440, 1975.
- [4] Korean Standards Association, *Korean Industrial Standard KS C6409*. 1970.
- [5] John G. Woods and Henry D, "Contact resistance and contact resistance variation in thick film trimming potentiometers", *IEEE Proc. Electronic Components Conference*, pp. 476-500, 1971.
- [6] George J. Russ., "A system for analyzing contact resistance", *IEEE Transactions on Components, Hybrids and Manufacturing Technology*, Sept. 1979.
- [7] C.D. Motechenbacher, *Low Noise Electronic Design*. John Wiley & Sons, Inc. pp. 1975.
- [8] 宮脇一男, 雜音解析 朝倉書店 14장, 1975.
- [9] 齊藤正男, 低雜音電子回路設計, 1, 12장, 1977
- [10] 電子通信社社長, 電子通信學會 8 卷, 1967.
- [11] 大谷杉郎, 炭素纖維, 近代編集社, 1, 2 장, 1979.
- [12] OHM社, 抵抗器, 日刊工業新聞社, PP. 161, 1967.